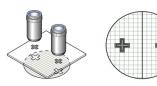


Ручная установка совмещения и экспонирования ЕМА-400



Установка совмещения и экспонирования ЕМА-400 предназначена для использования в лабораториях, исследовательских центрах, университетах для выполнения НИОКР и мелкосерийного производства. Это экономичное и компактное оборудование, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками.

Для совмещения реперных меток используется двупольный микроскоп с расщепленным полем. Расстояние между оптическими осями объективов регулируется в пределах 15-75 мм, что позволяет работать как с фрагментами пластин, так и с целыми пластинами диаметром до 100 мм.

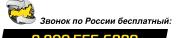


Возможные области применения:

Актуаторы; датчики давления; датчики ускорения; силовые приборы; оптоэлектронные компоненты; Flip Chip / BGS / CSP компоненты

Технические характеристики

Параметры	EMA-400
Размер пластин	Фрагменты пластин или целые пластины диаметром до 100 мм
Размер фотошаблона	До 127 x 127 мм (5"x5")
Точность совмещения	± 3,0 мкм
Метод экспонирования	Мягкий контакт, жесткий контакт, с микрозазором
Разрешение	3 мкм (мягкий контакт); 2 мкм (жесткий контакт)
Регулируемое расстояние между осями объективов	От 15 до 75 мм
Общее увеличение	До 100х
Диапазон перемещений столика для пластин, XY и θ	± 5 мм, ±5°
Модуль экспонирования	250 Вт ртутная лампа высокого давления, 405 нм Диаметр области экспонирования до 100 мм Параллельность пучков в пределах 1° Интенсивность 20 ± 5% мВт/см2 Цифровой таймер для контроля времени экспонирования
Коммуникации	Электропитание: 100 В, 50/60 Гц, 15А; вакуум: -80 кПа; азот или СЧВ: не менее 0,2 МПа



Технологическое оборудование и расходные материалы для производства электроники